

	L #	Hits	Search Text	DBs
1	L1	6	"6277532"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
2	L2	1487	430/394.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
3	L3	146197	(electron or particle) adj3 beam	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
4	L4	7847	430/5.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
5	L5	414753	mask or photomask or reticle	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
6	L6	166798 6	holes	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
7	L7	381089	membrane	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
8	L8	563969	stress stresses	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
9	L9	135751	strut or skirt	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
10	L10	182775 6	block	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
11	L11	127591 2	align\$	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
12	L12	881	3 same 9	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
13	L13	135	12.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
14	L14	36673	9.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
15	L15	135	13 14	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
16	L16	15	15 4	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
17	L17	439217	etch etching etched	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
18	L18	280920 1	remove removing removed	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
19	L19	37	13 18	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
20	L20	2	10/467123	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO